⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 5317

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)1月11日

G 05 D 3/12

7623-5H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

ᡚ発明の名称 自動焦点合わせ装置

②特 願 昭59-124821

②出 願 昭59(1984)6月18日

四発 明 者 筒 井 敬 一

京都市右京区花園土堂町10番地 立石電機株式会社内

⑪出 願 人 立石電機株式会社

京都市右京区花園土堂町10番地

邳代 理 人 弁理士 岩倉 哲二 外1名

射 相 自

1.発明の名称

自動焦点合わせ装置

2. 特許請求の範囲

3.発明の詳朝な説明

《発明の技術分野》:

この発明は、半導体製造に用いられるマスクア ライナーや、その他の光学式の測定および検査装 體における自動焦点合わせ装置に関する。

《従来技術とその問題点》

半導体装置の製造に使用するマスクアライナーとして、半導体ウェハ面にマスクバターンを投影結構し、マスクとウエハを位置合わせした後、露光するプロジェクションアライナーが知られている。

このプロジェクションアライナーにおいては、 機種なマスクパターンをウェハ上に高精度に焼付けるために、ウェハ表面をマスクパターンの結像 面(以下、焦点面とする)に正確に位置合わせす ることが重要である。

従来のプロジェクションアライナーにおいては、 レンズ鏡間とウェハ表面の際間を光学センサやエ アマイクロセンサを用いて測定するとともに、ウ エハを載置したチャツクの上下移動(レンズ系の 光輪方向の変位)をモータや空気圧を利用したア

クチエータによつて行つていた(例えば特異的 56-2630,号公報参照)。しかし、半導体レ ーザーやLEDなどによる光学センサを用いた従 来の自動焦点合わせ装置では、変位測定対象物で あるウェハ表面が一様な傾面状態でないと正確な 変位測定が行えないという周囲がある。実際のウ エハ表面は完全な表面状態ではなく、ある程度の 凹凸を含んである。そのためウェハの変位測定類 にパラツキが生じ、それが位置決め課差となる。 また、空気流を利用してウェハの位置を測定する エアマイクロセンサを用いた従来装置では、検出 系の応答速度が遅いという大きな欠点があつた。 また、ねじ送りなどの機械的な構成で高精度を実 現するには、極めて高度な技術が必要で高価なも のとなる。また、空気圧を利用したアクチェータ でウェハを変位させる機構では、エアマイクロセ ンサ以上にその応答性が悪い。

上述のような問題はプロジェクションアライナーだけの問題でなく、光学式の各種素定および検査装置においても同様である。

各微小変位センサの出力に基づいてそれぞれに対応する上記各圧電アクチェータを駆動する微調整 用制御回路とを備えたことを特徴とする。

《実施例の説明》

第1図は本発明による自動焦点合わせ装置を搭載したプロジェクションアライナーを示す。 同図において、9は定盤、8は定盤9の水平面に搭載

《発明の目的》

この発明の目的は、レンズ系の鏡間前方の焦点面に板状物体の表面を一致させる様に位置決めする装置において、板状物体の表面のある程度の凹凸には影響されずにその凹凸を平均化した状態で位置決めが行え、しかも検出系および板状物体の変位駆動系ともに歯単な構成で高速応答性が出現できるようにした自動焦点合わせ装置を提供することにある。

【発明の構成と効果》

されたXYステージ8、7はXYステージ8の可動部に搭載された回転ステージ、6は回転ステージ7の可動部に搭載された粗調整用上下変位機構6の可動部に固設された可動基台である。また、30はレンズ銭展、3はレンズ 銭刷30の中心に配設されているレンズ系をそれぞれ示している。

レンズ系3の光軸は垂直方向に設定されてる。可動を含むな平の基合であり、レンズ鏡側30の場合であり、レンズ鏡側30の中であり、レンズ鏡側30の中であり、レンズ鏡側30の中である。可数基合であり、などではないであり、などではよって変して変して変した。これをでは、粗調整用上下変位機構6はモータ等を駆動機とする機械的な装置である。

可動基台 5 の上面に 3 個の圧電アクチェータ 1 A . 1 B . 1 C を介してウエハチヤツク 4 がほ は平行に搭載されている。このウエハチヤツク 4 にウエハ11が戦闘される。3個の圧電アクチにロータ1A,1B,1Cは正三角形をなす位にレンーの正三角形の中央部がある。圧電アクチに配ぶるの光軸が通る状態となる。圧電アクチに発展を関すると、不可をは圧電圧を加えると、不高にないまる。この圧電アクチェータ1A,1B・1Tでのよる。この圧電アクチェータ5に対する。この圧電アクチェータ5に対する。この圧電アクチェータ5に対するでにないませるように構成されている。

レンズ銀腸30の端面部分には、レンズ系3を取開む正三角形をなす位置に、3個の静電容量式 微小変位センサ2A、2B、2Cが取付けられている。この様子を第2図および第3酉に示してい る。センサ2Aは圧電アクチェータ1Aと対応し、センサ2Bは圧電アクチェータ1Bと対応し、センサ2Cは圧電アクチェータ1Cと対応する。

静電容量式微小変位センサ2A, 2B, 2Cは そのセンサ面がウエハ11表面に対向するように 取付けられており、センサ面とウエハイ自出し、物が関係を発生する。第5回は静電を発生する。第5回は静電を発生する。第5回は静電を発生する。第5回は静電を発生する。第5回の関係を発生する。第5回の関係を発生する。第5回の対域にもなり、その円柱増るのウェッカーのでは、での回いがある。では、サカーのでは、からの回いがある。では、サカーのでは、サービーは、サービーを表し、サービーは、サー

最終的な位置決め時には圧電アクチエータ1Aはセンサ2Aの出力に基づいて駆動され、圧電でクチェータ1Bはセンサ2Bの出力に基づい、圧電アクチェータ1Cはセンサ2Cの出力に基づいて駆動され、センサ2A.2B.2Cの各点に超に一致するように制御される。第6図の集点の制御回路系の1つを示している。この回路

はセンサ2Aとアクチェータ1Aとの組についてのものである。センサ2Aの出力は増幅器115で増幅され、センサ2Aとウエハ11との測定距離はに対応した電圧Vdが出力される。この検出電圧Vdと予め設定された基準電圧Voとが差動増幅回路16の入力となり、この回路16で得られた偏差電圧ΔVが駆動回路18の入力となる。

駆動回路18は傷差電圧 △ V に応じた電圧を圧電アクチエータ1Aに印加し、センサ2Aによる検出距離 I が焦点距離になるように圧電アクチエータ1Aを変位させ、ウエハチャック4およびウエハ11を変位させる。この制御が他の圧電アクチエータ18、1Cについても同様に行われる。

なお、説明が前後するが、上述のアクチエータ 1 A 、 1 B 、 1 C によるウエハ 1 1 の微調整に先 だつて、 X Y ステージ 8 、回転ステージ 7 、上下 変位機構 6 によつてウエハ 1 1 の位置の組調整が 行われる。上下変位機構 6 で位置決めを行う無に も、静電容量式微小変位センサ 2 A 、 2 B 、 2 C を利用する。

4. 図面の簡単な説明

1 A 、1 B 、1 C … 圧電アクチエータ、2 A 、2 B 、2 C … 静電容量式微小変位センサ、3 … レンズ系、3 O … レンズ鏡順、4 … ウエハチャツク(支持台)、5 … 可動基台、6 … 相調整上下変位機構、1 1 … ウエハ(板状物体)。

特許出願人 立石電機株式会社 代理人 弁理士 岩倉哲二(他1名)

特開昭61-5317(4)







